白色光源用 SLD SD3S207T/208T/209T

SD3S207T/208T/209T Superluminescent Diodes

UDC 621.375 : 681.7.069.24 : 621.382

山田敦史	Atsushi Yamada	研究所	光デバイス技術プロジェクトチーム
山口優子	Yuko Yamaguchi	研究所	光デバイス技術プロジェクトチーム
篠 根 克 典	Katsunori Shinone	研究所	光デバイス技術プロジェクトチーム

1 はじめに

高出力でスペクトル幅が狭くファイバへの結合効率が高い レーザダイオード(LD)に対して,発光ダイオードは発光スペ クトルが広く低出力である。これに対しスーパルミネッセン トダイオード(SLD)は両者の中間的な特徴を持つ素子で,LD の端面反射率を十分下げ,自然放出光を誘導放出により増幅 することで実現される。このため,高出力で広い波長範囲を持 つ低コヒーレントな光を指向性良く放射できる特徴を持つ¹⁾²⁾。 これらの特徴により白色光源,光ファイバジャイロ³⁾,高分解 能OTDR⁴⁾などの光計測の分野に応用されている。近年では光 生体観測⁵⁾,エンジン燃焼モニタ⁶⁾などの分野への応用も検討 され始めている。

一方,波長多重(WDM)通信は実用段階に入り,光ファイバ 増幅器,光アイソレータ,光カプラなどの光部品に対する性 能評価への要求も高まりつつある。これに対応して計測器事 業本部においてポータブル光スペクトラムアナライザ MS9710BおよびWDMテスタMS9715Aが開発された"。これ らの装置ではSLDと基準用のガスセルを搭載することにより 自動的な絶対波長校正を可能としている。また,光スペクト ラムアナライザではSLDを白色光源として使うことで,光部 品の波長特性の測定におけるダイナミックレンジが,八ロゲ ンランプを使った場合と比べて大幅に拡大できる。従来SLD の波長半値幅は50nm 程度であったが^{®)},これらの目的のため に特に広帯域の波長半値幅と低い波長リップルを持つように 設計した長波長帯SLDを開発した。ここではその構造と特性 を紹介するとともに応用例についても報告する。

2 _{基本構成}

2.1 設計方針

まずSLDに求められている素子性能をまとめる。 1.55 µ m帯光部品の波長帯域を検出できる広波長帯域 波長基準用ガスセルの吸収線を検出可能な低リップル 両端面の出力をそれぞれ利用できる前後方出力

これらの性能を満足させるために従来のSLDに対して,以下に述べる点を改善した。

2.2 活性層構造

以前から製作してきた長波長 SLD SD3S205 は高出力をねら いBULKの活性層構造を採用した。図1 に示す通り BULK 活性 層における状態密度関数は放物線型である。注入キャリアの 分布は状態密度とフェルミ分布との積になるので,光出力が 大きくなる反面,波長半値幅の拡大はそれほど望めない。こ



図1 BULKの状態密度関数と電子のエネルギー分布 Density of states and energy distribution of electron in bulk semiconductor



エネルギー

図2 量子井戸の状態密度関数と電子のエネルギー分布 Density of states and energy distribution of electron in a quantum well

のため,スペクトル帯域が狭く白色光源としての用途には適 していない。量子井戸構造では状態密度関数が階段状で(図2) 高電流密度の時の注入キャリアのエネルギ分布がBULKの時 に比べて広がるために,波長帯域の広帯域化が期待できる⁹。

LDでは量子井戸の井戸層に圧縮歪をいれることで特性改善 をねらうことが多い。しかし,単に圧縮歪をいれるだけでは 内部応力の関係上,井戸層厚を厚くとれないので長波長SLD では光出力が下がる傾向にある。一方,引張り歪をいれると 光出力が向上する上にSLDの偏波依存性が低減できるという メリットも生じる。しかし,これではアイソレータが出力側 に入っているために,ここで3 dB落ちて結局出力が上がらな い。このため今回のSLDでは井戸層は無歪みにして,偏波特 性と光出力の両方の特性が満足できるような設計値とした。

実際の素子は,有機金属気相成長(MOVPE)法と液相成長 (LPE)法を用いて作製した¹¹⁾¹²。図3に作製した素子のエネル ギーバンドダイヤグラムの設計値を示す。井戸層は5層で無 歪のInGaAs,障壁層に1.3µm組成のInGaAsPを用いた。ま た,光とキャリアを有効に井戸層内に閉じ込めるために3層 のステップ型GRIN-SCH構造を用いた。井戸幅と障壁層の厚 さはそれぞれ95,90 である。波長帯はWDMなどの光通信 用として用いられる1.55µm帯である。レーザでは発振する と注入キャリア密度が固定され,それ以上増えなくなる。し かしSLDではしきい値がなく電流値に応じてキャリア密度が 上昇していくため,ピーク波長が短波長側にシフトしていく。 この現象を考慮して井戸層厚の設定波長は使用波長より長い 約1.59µmとした。



2.3 素子構造

SLDはレーザ発振を抑圧するために素子端面での反射率を 極力落とす必要がある。長波長SLD SD3S205では両端面に無 反射コートしたうえ,後面の反射率の低減のために吸収領域 を設け,さらにウエットエッチングを行い溝を設けて活性層 への反射率を構造的に下げている[®]。この場合スペクトルのリ ップルは1dB以上になることもあるが,大抵の用途にはこれ で十分であった。しかし,今回はアセチレンの吸収線を安定 して検出する必要があるためさらに低減する必要がある。し かも,溝方式のSLDでは片側の出力が犠牲になるので後方出 力を利用することは困難になる。このために,光源出力と基 準出力に両端面の出力それぞれを利用する光スペクトラムア ナライザなどの用途には適用できなかった。今回我々は溝方 式に換えて,半導体光増幅器で実績のある端面窓構造に加え なおかつ無反射コーティングを両端面に導入し,反射率を極 限まで下げることでこれらが可能になった¹⁹。

図4にSLDの素子構造を示す。埋め込み構造には,n型基 板で実績のあるRVN構造を採用した¹⁴⁾。端面にはSiOxによる 無反射コートを施した。反射率はLD端面に片端ずつコーティ ングしたときの出力前後比変化の測定により,約0.2%と見積



図4 素子構造図 Schematic configuration of SLD

もられた。さらに,端面近傍で活性領域を途切れさせる窓領 域を設けた。窓領域内では,光は閉じ込められずにガウスビ ームとして拡散しながら伝搬していくため,素子端面で反射 した光は活性領域まで戻ってきた時には最初のスポットサイ ズより大きくなる。このため,反射してきた光は元の活性領 域に対して再結合しにくくなる。したがって,窓構造は活性 領域に対して等価的に端面反射率を下げる効果がある。反射 ビームは窓領域長が長いほどビームスポットが大きくなるの で,長さに応じて反射率低減効果が得られる。ここでは出力 ビームパターンの乱れを避けるために窓領域長は約30 µ mに 設定した。無反射コートの場合と同様,片側に窓構造をつけ た素子で見積もった結果,反射率が窓構造だけで約1/10以下 にすることが可能になった。この結果,窓構造と無反射コー トの合計の反射率として0.02%以下を得ている。

2.4 素子作製工程

素子作製工程を図5に示す。

まず, n-InP(100)基板上に, n-InPバッファ層, MQW活性層,



p-InPクラッド層を成長する。プラズマCVDでSiNx 膜を堆積 し窓構造用のパターンをつけた後,p-InPクラッド層を再成長 する。この後さらにプラズマCVDで<011>方向のストライプ のパターンを作製後,プロムメタノール,塩酸系エッテャン トを用いてRVN構造のメサを形成する。次にLPE法により2 回の結晶成長を行い,p/n-InP電流プロック層埋め込みおよび クラッド/コンタクト層を形成する。続いて研磨,電極形成 工程後へき開し,ヒートシンク上にAuSnはんだを用いてマウ ントする。

3 特性

3.1 光出力特性

SLDではLDのようなしきい値を持たないため光出力は注入 電流に応じてなめらかに上昇していく。25 , 直流100mAで 最大0.32mW, 平均でも約0.25mWの出力が得られている。

3.2 スペクトル特性

SD3S208T/209Tは光スペクトラムアナライザMS9710Bのオ プションの基準光源/白色光源として使用されるため広い波 長帯域が要求される。SD3S208Tは基準光源または白色光源の どちらかのみの機能を得るため片側出力を規定している。こ れに対しSD3S209Tでは,その両方の機能を得るために両端面 出力それぞれの出力特性を確認した上,その出力前後比も規 定している。動作電流100mAの時の代表的なスペクトル特性 を図6に示す。100mAにおいて-3dBで約90nm,-10dBでは約 160nmの波長範囲が得られている。



Emission spectrum



図7はこの素子の規格値である1.55 µ m ± 20nmの波長帯域 で測定したスペクトル特性を示す。フラットネスはこの波長 範囲内の光出力の最大値と最小値の差と定義している。この素 子の場合2.3dB程度であった。スペクトルリップルは分解能 0.1nmで測定した時,約0.2dBと良好である。 WDM テスタ MS9715A は波長基準として 1.52 µ mに吸収 線を持つアセチレンのガスセルを内蔵している。SD3S207T はこの基準光源用の光源として使用される。この場合, SLD は吸収線が観測できればよいので,波長帯域に対する 要求は光スペクトラムアナライザ用より低い。しかし,他 の SLDより出力レベルを要求されるという違いがある。 100mA の時のスペクトル特性を図 8 に示す。また,表1 に それぞれの素子に対する主な要求仕様を示す。

4 _{応用例}

SLD 光源と光スペクトラムアナライザ MS9710Bを用いた 測定例を以下に示す。図9は可変波長のバンドパスフィルタ の透過特性を測定した例である。(a)はシングルパス構成で, (b)はマルチパス構成によりダイナミックレンジを拡大した フィルタの例である。あらかじめ測定しておいたSLD 光源 のスペクトル特性分を補正して透過スペクトルとしてある。 なお,この時の電流値は100mAである。従来光部品の波長 特性を測定するにはハロゲンランプを用いた白色光源を使 っていたが,このSLDを白色光源として用いることで20dB 以上ダイナミックレンジを拡大できる。このため図9(b)の ようなフィルタでも十分な測定が可能になった。

光スペクトラムアナライザ MS9710B と波長可変光源 MG9637A/9638A を使えば同様な測定をより高ダイナミック レンジで行うことが可能である。しかしこの場合,波長範 囲が限られており,より広い範囲にわたって測定したいと きにはSLDを使った構成が有効である。図10は光ファイバ 用のWDM モジュールを測定した例である。これは光増幅 器に使われる光部品で励起用の1.48 μ mのLD光源と信号

記号	測 定 条 件	SD3S207T	SA3S208T	SD3S209T	単位
Pout	lf = 100mA		-8.0 MIN.	-7.0MIN.	dBm
S ₁	If = 100 mA	-34.0 MIN.			dBm
R _{pl}	If = 100 mA	0.3 MAX.	0.3 M A X.	0.2 M A X.	dB
R	If = 100 mA			6.0 TYP.	dB
Vf	If = 100 mA	1.2 TYP.	1.2 TYP.	1.2 TYP.	V
F ₁	lf = 100mA , = 1.53 - 1.57 μ m		3.0 M A X.	3.0 M A X.	dB
D _i	lf = 100mA			1.0 MAX.	dB
Pte	lf = 100mA			- 7.5MIN.	dBm
	記号 P _{out} S ₁ R _{pl} R V ₁ F ₁ D _i P _{te}	記号 測定条件 P _{out} If = 100mA S ₁ If = 100mA R _{pl} If = 100mA R If = 100mA V _r If = 100mA V _r If = 100mA F ₁ If = 100mA, = 1.53 - 1.57 μ m D _i If = 100mA P ₁₀ If = 100mA	記号 測定条件 SD3S207T Pout If = 100mA -34.0 MIN. St If = 100mA -34.0 MIN. Rpt If = 100mA 0.3 MAX. R If = 100mA 1.2 TYP. Vr If = 100mA 1.2 TYP. F1 If = 100mA 1.2 TYP. P1 If = 100mA 1.53 - 1.57 μ m ID1 If = 100mA If = 100mA	記号 測定条件 SD3S207T SA3S208T Pout If = 100mA -8.0 MIN. St If = 100mA -34.0 MIN. Rpt If = 100mA 0.3 MAX. R If = 100mA 0.3 MAX. Vr If = 100mA 1.2 TYP. F1 If = 100mA , = 1.53 - 1.57 μ m 3.0 MAX. Pte If = 100mA 1.2 TYP.	記号 測定条件 SD3S207T SA3S208T SD3S209T Pout If = 100mA -8.0 MIN. -7.0MIN. St If = 100mA -34.0 MIN. -7.0MIN. Rpt If = 100mA 0.3 MAX. 0.3 MAX. 0.2 MAX. R If = 100mA 1.2 TYP. 1.2 TYP. 1.2 TYP. Vr If = 100mA , = 1.53 - 1.57 µ m 3.0 MAX. 3.0 MAX. IDi If = 100mA 1.0 MAX. 3.0 MAX.

表1 電気的,光学的特性 Electrical and optical characteristics

*1 S1 = Sf + (P0 - Pf) Sf: 波長1520nm でのスペクトルレベル (分解0.2nm, SMファイバ出力) P0: 素子光出力

Pf: SM ファイバ光出力

*2 波長範囲 1.53 ~ 1.57 µ m までの最大値と最小値の差

光である 1.55 μ mの光を合波するためのモジュールである。 光源に SLDを使うと,それぞれの入力端からみた損失特性が 1.45 から 1.60 μ mまでの波長範囲で測定できる。ダイナミッ クレンジの低下を許せば,より広い波長帯域で測定すること も可能であるため,光ファイバカプラや光アイソレータの波 長特性の測定などに広く利用できる。

5 vyv

光スペクトラムアナライザ M S9710B や WDM テスタ MS9715A に,ガスセルを使った絶対波長基準を測定するため の光源が要求された。同時に MS9710B には1.55 µ m帯光部品 の波長特性の測定ができるように,従来の SLD にはない広波 長帯域,低リップルの SLDを開発した。活性層に無歪量子井戸 構造を採用して広帯域化を図るともに,端面窓構造と無反射 コーティングを併用することで端面反射率を抑制し低リップ ルを実現した。100mA の時,波長半値幅約90nm,スペクトル リップル0.2dB 以下,光出力0.32mW が得られた。



SLD は高出力で広い波長範囲を持つ低コヒーレントな光を 指向性良く放射できる特徴を持つため,以前から白色光源や 光ファイバジャイロ,高分解能OTDR などの光計測の分野へ 利用されている。近年は,光生体観測や燃焼モニタとしての 応用も検討されている。今後はこれらの新しい用途のSLD開 発を行っていきたい。また,全MOVPE 成長プロセスを導入 してコスト低減を図るとともに素子構造を改善し,性能向上 をはかる予定である。

参考文献

- 1)三上: "スーパールミネッセントダイオードの光学的特性と応用", 光学,第19巻,第3号,pp143-149
- 2)吉田谷: "スーパールミネッセントダイオード", 光アライアンス, Vol.8, No.8, pp32-35
- 3) V. Vali, W. Shorthill: "Rapid Communications "Appl. Opt. Vol.15, No.5,









pp1099-1100 (1976)

- 4) K. Takada, A. Himeno, and K. Yukimatsu: "High sensitivity and submillimeter resolution optical time-domain reflectometry based on lowcoherence interference," J. Lightwave Technol. vol. 10, 1998-2005, 1992
- 5)春名:"生体光計測の現状と将来",光学,26巻,9号,pp456-460, (1997)
- 6) M. Komachiya, H. Sonobe, S. Oho, M. Kurita, T. Nakazawa and T. Sasayama: "Multiple in-cylinder pressure measurement utilizing an optical fiber with specific refractive-index composition", Appl. Opt., 35, pp. 1143-1150 (1996)
- 7)太田垣,柿本,津田,山口,石綿: "ポータブル光スペクトラムアナ ライザ MS9710B / WDM テスタ MS9715A" アンリツテクニカル No.74, Oct. 1997, pp55-65
- 8)山口: "長波長帯高出力SLD", アンリツテクニカル, No.61, Apr. 1991,

pp84-91

- 9) 岡本: "超格子構造の光物性とその応用", pp2-17, コロナ社, 昭和63年
- 10) 深谷,谷本,遠藤,大立目,池内,岡村,長島:"波長可変光源 MG9637A/MG9638A", No.74, Oct. 1997, pp66-71
- 第根,小野,東門,金谷: "全MOVPE成長による長波長帯埋め込み
 型半導体レーザ",アンリツテクニカル, No.69, Mar. 1995, pp9-15
- 12) 菊川, 下瀬, 鈴木, 金谷, 篠根: "EDFA 励起用 MOVPE 成長高出力 MQW レーザ", アンリツテクニカル, No.64, Oct. 1992, pp78-87
- 13)山田,尾坪,浅井,篠根,大貫,芦田:"半導体光増幅器",アンリ ツテクニカル, No.67, Mar. 1994, pp22-27
- 14)牧田,山口,亀田,浅井,堀内,村上,尾登,吉田谷:"高出力 InGaAsP/InP系新埋め込み構造半導体レーザ", No.60, Sept. 1990, pp140-147